



SUOMI-FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan **942249**

(51) Kv.1k.5 - Int.cl.5

C 08L 83/04

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag **13.05.94**

(24) Alkuperä - Löpdatum **13.05.94**

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig **15.11.94**

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet

14.05.93 JP 5-113455 P

(71) Hakija - Sökande

1. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, (JP)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Irifune, Shinji, 3-13-37, Isobe, Annaka-shi, Gunma-ken, Japan, (JP)

2. Ohba, Toshio, 3-5-5, Haraichi, Annaka-shi, Gunma-ken, Japan, (JP)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Säteilykovettu organopolysiloksaanikoostumus
Strålningshårdbar organopolysiloxankomposition

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Keksintö koskee säteilykovettuvaa organopolysiloksaanikoostumusta, joka kykenee tuottamaan alustan pinnalle kovettuneen pintakalvon, jolla on erinomainen irrotettavuus takertuvista aineista. Koostumus saadaan yhdistämällä määrättyssä painosuhteessa kahdenlaisia (met)akryylioksialkyyliä sisältäviä organopolysiloksaaneja, joista toisella on suhteellisen suuri polymeroitumisaste, mutta joka sisältää suhteellisen pienen määrän piihin sitoutuneita (met)akryylioksialkyyliyhymiä, kun taas toisella on suhteellisen pieni polymeroitumisaste, mutta joka sisältää suhteellisen suuren määrän piihin sitoutuneita (met)akryylioksialkyyliyhymiä. Keksintö koskee myös menetelmää irrotettavan pinnoitteen muodostamiseksi alustan pinnalle käyttämällä mainittua koostumusta.

Uppfinningen avser en strålningshårdande organopolysiloxankomposition, vilken förmår avgiva en hårdad ytfilm på en substratyta, vilken uppvisar en utmärkt lösgörningsförmåga gentemot klibbade substanser. Kompositionen erhålls genom kombinerande av två sorters (met)akryloxialkylhaltiga organopolysiloxaner i en bestämd viktproportion, av vilka den ena har en relativt hög polymeriseringsgrad men innehåller en relativt liten mängd av de kiselbundna (met)akryloxialkylgrupperna, medan den andra har en relativt låg polymeriseringsgrad men innehåller en relativt stor mängd av de kiselbundna (met)akryloxialkylgrupperna. Uppfinningen avser även ett förfarande för bildande av den lösgörande beläggningen på substratyten med användning av nämnda komposition.